УДК 548.73/.75+621.315.592 PACS number: 71.18.+Y

ISSN 1729-4428

Б.К. Остафійчук, В.М. Пилипів, В.Д. Федорів, В.О. Коцюбинський, О.О. Григорук

Особливості радіаційного дефектоутворення в приповерхневих шарах епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату при імплантації іонами фосфору

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна e-mail: v kotsuybynsky@mail.ru, тел: +8(097) 3803959

В роботі на основі даних конверсійної месбауерівської спектроскопії та математичного моделювання процесу іонної імплантації досліджено процес генерації радіаційних дефектів у монокристалічних епітаксійних плівках залізо-ітрієвого гранату, опромінених іонами P+ з енергією 65 кеВ та дозами $5 \cdot 10^{14}$, $1,8 \cdot 10^{15}$ та $1 \cdot 10^{16}$ см⁻². Розглянуто механізми розвпорядкування кристалічної і магнітної мікрострукутри імплантованого шару.

Ключові слова: залізо-ітрієвий гранат, іонна імплантація, радіаційні дефекти, конверсійна месбауерівська спектроскопія.

Стаття поступила до редакції 21.07.2006; прийнята до друку10.10.2006.

Вступ

взаємозв'язку Вивчення структурних та магнітних властивостей епітаксійних плівок - 31 структурою гранату та способів їх цілеспрямованої модифікації активно продовжується, що зумовлюється можливістю створення планарних хвилеводних структур та лазерів, їх застосування в якості активного середовища для пристроїв надвисокочастотної техніки та систем енергонезалежної магнітної пам'яті.

Одним з найпоширеніших методів модифікації приповерхневих шарів ферит-гранатових плівок є іонна імплантація, яка, завдяки можливості контролю кількості введених атомів та керуванню розподілу зміщених іонів матриці та механічних напруг з глибиною порушеного шару, дозволяє індукувати цілеспрямовані зміни кристалічної та магнітної мікроструктури, що, в свою чергу, дає можливість ефективного перетворення імпульсного НВЧ-сигналу в біжучі спінові хвилі, генерації даних хвиль з набагато меншими втратами та довжиною, "жорстких" полавлення магнітних доменів, створення каналів їх просування.

I. Об'єкти та методи дослідження

Плівки залізо-ітрієвого гранату номінального складу $Y_3Fe_5O_{12}$ були вирощені методом рідкофазної епітаксії в промислових умовах на діелектричній немагнітній підкладці галій-гадолінієвого гранату $Gd_3Ga_5O_{12}$ товщиною близько 500 мкм. Досліджувані плівки товщиною 10,2 мкм були орієнтовані в площині (111), кут розорієнтації не перевищував 7'. Температура переохолодження розчину-розплаву складала 10°С, температурний режим підтримувався точністю до 0,1°C. Поверхня зразків 3 протравлювалася в ортофосфорній кислоті при температурі 130°С для зняття тонкого неоднорідного шару "плівка-повітря" товщиною 10-15 нм. Зразки опромінювалися іонами фосфору з енергією 65 кеВ та дозами 5.10¹⁴, 1,8.10¹⁵ та 1.10¹⁶ см⁻². Імплантація проводилась при кімнатній температурі на установці типу "Везувій" в режимі, що виключав каналювання. Для запобігання ефекту самовідпалу густина струму імплантації не перевищувала 2 мкА/см². Для дослідження магнітної мікроструктури застосовувався метод конверсійної електронної месбауерівської (КЕМ) спектроскопії. Спектрометр типу ЯГРС-4М працював у режимі постійних прискорень. Для поліпшення якості КЕМ спектрів заліза у вихідній шихті використовувався оксид

 Fe_2O_3 , збагачений до 8 % ізотопом Fe^{57} . КЕМ спектри Fe^{57} отримувалися при кімнатній температурі з використанням джерела гамма-квантів Co^{57} в хромовій матриці з активністю ~ 30 мКи в режимі постійних прискорень. Для реєстрації конверсійних електронів використовувався пропорційний газопроточний лічильник, що працював на суміші 96% He + 4% CH_4 . Калібрування КЕМ спектрів заліза проводилось відносно металічного α -*Fe*.

II. Постановка задачі

Кристалічна структура ЗІГ належить до кубічної просторової групи *Ia3d*, на елементарну гратку припадає 16 кристалографічно еквівалентних іонів Fe в октакоординованих (а) порожнинах з точковою симетрією 3 та 24 еквівалентних іонів Fe в тетеракоординованих (d) порожнинах з точковою симетрією 4. Точкові групи для *а*-та *d*-позицій *Fe* визначають аксіальну симетрію тензорів градієнтів внутрішньокристалічних електричних полів (ГЕП), осі симетрії яких співпадають, відповідно, 3 кристалографічними напрямками {111} та {100}. Месбауерівська спектроскопія дозволяє розділити вклади окремих груп іонів Fe з різними значеннями кута в між напрямками ГЕП та вектором їх сумарного магнітного моменту, який є паралельним до напрямку ефективного магнітного поля H_{eb} на ядрах цих іонів. Таким чином, в загальному випадку месбауерівський спектр ЗІГ являє собою суперпозицію семи парціальних секстетів. Для монокристалічних плівок Y₃Fe₅O₁₂ з орієнтацією в площині (111) набір кутів скорочується до трьох $\theta_{a_1} = 0, \ \theta_{a_2} = 70^{\circ}52', \ \theta_d = 54^{\circ}44'$ і месбауерівський спектр можна апроксимувати трьома компонентами зі співвідношенням інтегральних інтенсивностей $S_d: S_{a_1}: S_{a_2} = d: a_1: a_2$. При іонній імплантації на початкових етапах набору дози відбуваються процеси радіаційного розвпорядкування: деформується симетрія локального оточення атомів в кристалічній гратці, перерозподіляється електронна густина та порушується геометрія обмінного зв'язку Fe_a-O-Fe_d. Збільшення дози опромінення веде до накопичення радіаційних дефектів, перекриття окремих каскадів атом-атомних зіткнень та появи радіаційно розвпорядкованих областей (PPO). Порушення непрямої обмінної взаємодії при руйнуванні кристалічної структури призводить до появи магнітонееквівалентних позицій заліза з меншими (порівняно з неімплантованим зразком) ефективними полями на ядрах, аж до появи парамагнітного стану іонів Fe Враховуючи це, при розшифруванні месбауерівських спектрів розділялися тільки *a*- та *d*-позиції *Fe* та отримувалися найімовірнісніші значення їх характеристичних параметрів. Вибір параболічної форми фону зумовлювався проявами геометричних факторів при наборі експериментального спектру, $t_{\text{набору}} = 48$ год.

III. Результати експерименту та їх обговорення

Здійснено моделювання процесу радіаційного дефектоутворення досліджувану в структуру. Вважалося, що генерація дефектів носить незалежний характер для окремих підграток оксидної сполуки. Розрахунки утворення каскадів атоматомних зіткнень здійснювалися в наближенні аморфної мішені, що забезпечувалося умовами експерименту (імплантація проводилась під кутом 7° відносно нормалі до площини плівки). Елементарний акт дефектоутворення – генерація френкелівської пари "вкорінений атом – вакансія". В рамках застосованої моделі утворення дефекту було можливим лише у випадку, коли енергія передана імплантантом іону мішені перевищує порогове значення E_d ($E_d = 66$, 56 і 40 еВ для Y^{3+} , Fe^{3+} та O^{2-} [1]). Вважалося, що дефектоутворення відбувається тільки внаслідок передачі енергії імплантантом в ядерну підсистему мішені внаслідок взаємонезалежних пружніх зіткнень. Застосовувався метол моделювання іонної імплантації. запропонований в [2].

Іон-імплантант в процесі гальмування втрачає свою енергію як внаслідок пружніх розсіювань на ядрах атомів мішені, так і непружніх зіткнень, зумовлених збудженням та емісією електронів в цих оболонках. Величина енергетичних втрат іону визначається співвідношенням $\frac{-dE}{dx} = N_0 \Big[S_n (E_i) + S_e (E_i) \Big], \quad \text{де} \quad N_0 \quad - \quad \text{середн} \varepsilon \quad \text{число}$ атомів в одиниці об'єму мішені (для ЗІГ $N_0 = 8,4.10^{22}$ iohib/cm³), E_i – eheprin ioha, $S_n(E_i)$ ta S_e(E_i) – перерізи ядерного та електронного гальмування відповідно. При імплантації ЗІГ іонами фосфору з енергією 65 кеВ домінують пружній тип гальмування (≈ 85 % енергетичних втрат), що становить ≈ 700 eB/нм (рис. 1) і передбачає розвиток каскадів вторинних зіткнень.

Розрахований профіль імплантації (приведений в розрахунку на одиничну дозу) та розподіли числа зміщених іонів матеріалу на одиниці пробігу імплантанта наведено на рис. 2. Відповідно до розрахунків, проективний пробіг іонів фосфору в структурі ЗІГ становить 46,2 ± 1,6 нм, тоді як процеси пружнього дефектоутворення простягаються 100 ± 3 нм. глибину до Радіаційне на розвпорядкування є найефективнішим в аніонній підгратці, для якої число зміщених іонів досягає 4,5 на нм пробігу імплантанта, що приблизно втричі перевищує аналогічний показник для підграток заліза. Максимум дефектоутворення припадає на зону 35 ± 5 нм, де ймовірність перекривання іонних треків та формування протяжних комплексів дефектів є максимальною.

Основною метою моделювання є встановлення ймовірності виникнення та характеру розвитку каскадних процесів генерації вторинних радіаційних дефектів. Інформацію про перебіг генерації і розвитку каскадів вторинних заткнень для 5000 іонівімплантантів було оброблено статистично (рис. 3). Для застосованих умов задачі максимальну імовірність зафіксовано для процесу генерації френкелівської пари – 47 %; для розвитку каскаду з 2 атомів віддачі – 15 %, 3 – 8 %, 4 – 6 % і т.д.



Рис. 1. Розрахункові залежності енергетичних втрат іону фосфору з енергією 65 кеВ у ЗІГ: 1– електронні, 2–ядерні, 3– сумарні втрати.



Рис. 2. Профілі розподілу числа зміщених іонів мішені (а) та імплантованих іонів фосфору (б) по товщині порушеного шару плівки ЗІГ.



Рис. 3. Ймовірність утворення каскадів вторинних зміщень з різним числом іонів.



Рис. 4. Енергетичні втрати імлантанта та зміщених іонів матриці на одиниці довжини пробігу.

Середній об'єм РРО становить $V_A = 0.05 \text{ нм}^3$. Розподіл значень V_A з товщиною порушеного приповерхневого шару володіє максимумом на глибині 40 ± 3 нм. Очевидно, що аморфізація структури буде розпочинатися саме в цій області з подальшим поширенням при збільшенні флюенса як до поверхні так і вглиб плівки, з остаточною товщиною 80 ± 5 нм. Енергетичні втрати імплантанта та зміщених іонів матриці мало змінюються з глибиною до 40 нм (рис. 4). Ймовірність розвитку підпорогових ефектів (структурного розвпорядкування при непружніх процесах збудження та іонізації електронних оболонок) досягає 15% на початок гальмування і різко зменшується з глибиною, що зумовлює можливість появи тонкого (декілька нм) аморфізованого шару на поверхні, де кристалічні зв'язки ослаблені, а швидкість імплантанту і, відповідно, вклад в електронну підсистему мішені, є максимальними. Згідно з [3] При кімнатній температурі РРО являють собою парамагнітні включення в феримагнітній матриці. Концентрація РРО визначається відповідно до [4] $c = A \cdot (1 - \exp(\beta \cdot D))$ (1), де β – коефіцієнт, пропорційний числу радіаційних дефектів в 1 см³ на один іон, $\beta = N \sigma_n V_0$, де N-концентрація іонів мішені ($N_{3IT} = 8,4'10^{22}$ см⁻³); σ_n – диференціальний переріз пружного дефектоутворення ($\sigma_n = 0.3.10^{-1}$ ¹⁹ см²); *D* – доза опромінення, V₀ – середній об'єм РРО, А – нормуючий множник. Аналогічно до [5] вважалося, що концентрація РРО прямо пропорційна вмісту парамагнітної відносному компоненти месбауерівського спектру. Залежність відносного вмісту парамагнітної компоненти від лози імплантації було апроксимовано формулою (1).



Рис. 5. Зміна відносного вмісту парамагнітної компоненти месбауерівського спектру (точки – експеримент, суцільна лінія – апроксимаційний розрахунок).

В результаті отримано значення об'єму РРО: $V_0 = (1,8 \pm 0,7) \cdot 10^{-18} \text{ см}^{-3}$, що відповідає лінійним розмірам 12 ± 5 нм. Конверсійні месбауерівські спектри вихідного та імплантованих зразків представлено на рис. 6, результати їх математичної обробки наведено в табл. 1.

Виявлено, що дозова залежність ефективних магнітних полів $H_{e\phi}$ на ядрах іонів заліза як в *a*-, так і в *d*-позиціях характеризується локальним максимумом при мінімальній дозі імплантації (рис. 7). Подібний ефект фіксувався в роботі [6].



а– вихідний, *в. г. д*–спектри плівок після імплантації іонами фосфору з дозами відповідно $5 \cdot 10^{14}$, $1,8 \cdot 10^{15}$ та $1 \cdot 10^{16}$ см⁻².

Таблиця 1

імплантації						
Доза, см ⁻²	Кристалографічна позиція	⊿ _s , мм/с	<i>Н,</i> кЕ	<i>б</i> , мм/с	<i>ю</i> , мм/с	S, %
Вихідний	а	0,10	495	0,63	0,40	33,2
	d	0,05	400	0,34	0,57	62,9
	D	2,40	-	0,48	0,53	3,9
5·10 ¹⁴	а	0,13	506	0,69	0,47	17,3
	d	0,01	408	0,47	0,68	35,4
	D	1,17	-	0,61	0,59	47,3
1,8·10 ¹⁵	а	0,09	488	0,73	0,65	17,3
	d	0,01	394	0,44	0,56	33,3
	D	1,22	-	0,55	0,58	49,4
1.10^{16}	а	0,12	485	0,64	0,43	14,5
	d	-0,02	392	0,42	0,66	29,7
	D	1,01	-	0,59	0,66	55,8
Похибка фітування		$\pm 0,03$	± 1	$\pm 0,04$	± 0,03	$\pm 0,3$

Параметри парціальних компонент експериментальних месбауерівських спектрів монокристалічної плівки *Y*₃*Fe*₅*O*₁₂ після



 δ ,MM/C 0.70 0.65 0.60 0.45 0.45 0.40 0.35 0.2x10¹⁵ 4x10¹⁵ 6x10¹⁵ 8x10¹⁵ 1x10¹⁶

Рис. 7. Залежність ефективних магнітних полів $H_{e\phi}$ на ядрах іонів заліза в *a*- і *d*-позиціях від дози опромінення.

зумовлюються деформаційно Зміни $H_{e\phi}$ індукованим перерозподілом спінової густини електронів s-оболонки атома Fe⁵⁷. На початковій стадії утворення РРО (доза імплантації 5·10¹⁴ см⁻²) імплантація викликає локальні зміни міжплощинної відстані – виникнення напруги розтягу в напрямку, перпендикулярному до площини плівки, і стиску – в напрямку паралельному. Водночас спостеріггається збільшення ізомерних зсувів (рис. 8), що свідчить про зменшенням ступеня ковалентності хімічного зв'язку Fe-O і пояснюється ростом віддалі обмінної взаємодії та зміною оточення атомів заліза, зменшенням перекриття електронних оболонок Fe^{3+} та O^{2-} і, як результат, локалізацією хвильової функції 4sелектронів на ядрі Fe^{57} . Набір дози призводить до об'єднання окремих аморфних парамагнітних

Рис. 8. Залежність ізомерного зсуву для ядер іонів заліза в *a*- і *d*-позиціях від дози опромінення.

кластерів розмірами ~ 0,1 нм³ (при моделюванні не враховувалися процеси анігіляції та можливість перекриття каскадів вторинних зіткнень) і утворення протяжних магніторозвпорядкованих областей з лінійними розмірами ~10 нм. Ріст дози імплантації призводить до різкого зменшення ефективних магнітних полів $H_{e\phi}$ на ядрах іонів заліза як в *a*- так і в *d*-позиціях, що зумовлюється руйнуванням кристалічної гратки і, відповідно, обмінних зв'язків *Fe-O*.

Зафіксовано наявність дублетної компоненти у неімплантованому зразку, яку, відповідно до величини квадрупольного розщеплення, однозначно можна приписати іонам Fe^{2+} у парамагнітному стані, причому можна стверджувати про значне перевищення енергії розщепленя енергетичних рівнів

3d-електронів кристалічним полем порівняно з енергією їх спарювання на одній орбіталі і про перехід заліза в високоспіновий стан [7]. Причиною зміни валентності та виключення іонів Fe з надобмінної взаємодії є поява у їх ближньому $+, Pb^{4+}$ Ta Pt^{4+} оточенні немагнітних іонів Рв24 Имовірність входження домішкових іонів, наявних в розчині-розплаві, в структуру, не дивлячись на додаткове перемішування шихти, максимальна на кінцевих етапах епітаксії, коли формується приповерхнева область плівки.



Рис. 9. Залежність величини квадрупольного розщеплення дублетної компоненти спектру від дози опромінення.

Спотворення та руйнування симетрії ближнього оточення атомів заліза при імплантації проявляється на дозовій залежності величини квадрупольного розщеплення дублетної комповенти спектру (рис. 9). Виявлено, що квадрупольне розщеплення має тенденцію до зменшення з ростом дози опромінення, що свідчить про збільшення відносного вмісту іонів або Fe^{3+} в високоспіновому, або ж іонів Fe^{2+} в низькоспіновому станах, про що говорять і величини ізомерних зсувів дублетної компоненти. Сепарувати вклади іонів в певних станах, враховуючи зміну ковалентності хімічного зв'язку та спотворення кристалічного і валентного градієнтів електричних полів, наведених на ядро Fe^{57} , не представляється можливим.

Висновки

1. При імплантації ЗІГ іонами фосфору з енергією 65 кеВ домінує пружній тип гальмування ($\approx 85 \%$ енергетичних втрат), що становить $\approx 700 \text{ eB/hm}$; високоймовірним є розвиток каскадів вторинних зіткнень.

2. При первинному дефектоутворенні (окремі каскади не перекриваються) максимально імовірним є процес генерації френкелівської пари −47 %; розвиток каскаду з 2 атомів віддачі − 15 %, 3 − 8 %, 4 − 6 %.

3. Проективний пробіг іонів фосфору в структурі ЗІГ становить $46,2 \pm 1,6$ нм, процеси пружнього дефектоутворення простягаються на глибину до 100 ± 3 нм.

4. Радіаційне розвпорядкування ефективніше в аніонній підгратці, для якої число зміщених іонів досягає 4,5 на 1 нм пробігу імплантанта, що приблизно втричі перевищує аналогічний показник для підграток заліза; максимум дефектоутворення припадає на зону 35 ± 5 нм.

5. Еволюція магнітного розвпорядкування передбачає перекриття окремих каскадів вторинних зміщень і утворення розвпорядкованих зон з лінійними розмірами ~10-12 нм, остаточна товщина «аморфізованого» шару становить 80 ± 5 нм.

6. Зафіксовано деформаційно індуковані зміни ефективного магнітного поля на ядрі $H_{e\phi}$ та ізомерних зсувів, що свідчить про зменшенням ступеня ковалентності хімічного зв'язку *Fe-O* і пояснюється ростом віддалі обмінної взаємодії та зміною оточення атомів заліза.

7. Зафіксовано наявність в неімплантованому зразку високоспінових іонів Fe^{2+} у парамагнітному стані.

Остафійчук Б.К. – д.ф.-м.н., професор; Пилипів В.М. – к.ф.-м.н., доцент; Федорів В.Д.– к.ф.-м.н., доцент; Коцюбинський В.О. – к.ф.-м.н., доцент; Григорук О.О. – аспірант.

- [1] Я.О. Довгый, В.И. Китык, А.О. Матковский, Д.Ю. Сугак, С.Б. Убизский. Квантово-механический подход к образованию дефектных состояний в гадолиний-галлиевых гранатах // ФТТ, **34(**4), сс. 1078-1087 (1992).
- [2] J.F. Ziegler, J.P. Biersack, U. Littmark. *The Stopping and Range of Ions in Solids*. Pergamon Press, New York. 321 p. (1985).
- [3] В.Н. Бережанский, В.Е. Петров, В.Л. Кокоз. Спин-волновой резонанс в ионно-имплантированных ферритгранатовых структурах // ФТТ, **33**(11), сс. 3372-3377 (1991).
- [4] P.H. Smit, H.A. Algra, T. Robertson. Effect of ion implantation on magnetic properties of neon implanted garnet layers // J. Appl. Phys., 53(2), pp. 207-209 (1982).
- [5] Ш.Ш. Башкиров, Н.Г. Ивойлов, Е.С. Романов. Влияние ионной имплантации на свойства нарушенного слоя феррогранатовых ЦМД пленок // ФТТ, 27(9), сс. 2853-2856 (1985).

- [6] Б.К. Остафійчук, Л.С. Яблонь, В.О. Коцюбинський. Кристалічна і магнітна мікроструктура приповерхневих шарів монокристалічних плівок LaGa-заміщеного залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами F⁺ // Фізика і хімія твердого тіла, **5**(4), сс. 744-749 (2004).
- [7] П.П. Серегин. Физика. Физические основы мессбауэровской спектроскопии: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГПТУ. 168 с. (2002).

B.K. Ostafiychuk, V.M. Pylypiv, V.D. Fedoriv, V.O.Kotsyubynsky, O.O. Grygoruk

Radiation Defect Formation Characteristics in Phosphorus Implanted Surface Layers of Yttrium Iron Ferrite-Garnet Films

Vasyl Stefanyk Precarpathion National University, 57 Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine

Radiation defects generation processes in phosphorus implanted (E = 65 keV, $D = 5 \cdot 10^{14}$, $1,8 \cdot 10^{15}$, $1 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-2}$) epitaxial yttrium iron garnet films on the base of Mëssbauer spectroscopy and simulation of implantation are investigated. The mechanisms of crystal and magnetic microstructure's transformation are considered. **Keywords**: yttrium iron garnet, ion implantation, radiation defects, Mëssbauer spectroscopy.